

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成31年3月22日(2019.3.22)

【公開番号】特開2019-7016(P2019-7016A)

【公開日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2019-002

【出願番号】特願2018-153439(P2018-153439)

【国際特許分類】

C 08 F	2/38	(2006.01)
A 61 K	6/00	(2006.01)
A 61 K	6/027	(2006.01)
A 61 K	6/083	(2006.01)
C 07 C	69/54	(2006.01)
C 07 F	9/09	(2006.01)
C 07 F	7/18	(2006.01)
C 09 D	4/00	(2006.01)
C 09 J	4/00	(2006.01)
C 09 J	11/04	(2006.01)
C 08 F	2/44	(2006.01)
C 08 F	20/10	(2006.01)

【F I】

C 08 F	2/38	
A 61 K	6/00	A
A 61 K	6/027	
A 61 K	6/083	5 0 0
A 61 K	6/083	5 3 0
C 07 C	69/54	C S P Z
C 07 F	9/09	K
C 07 F	7/18	L
C 09 D	4/00	
C 09 J	4/00	
C 09 J	11/04	
C 08 F	2/44	A
C 08 F	20/10	

【手続補正書】

【提出日】平成31年2月1日(2019.2.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

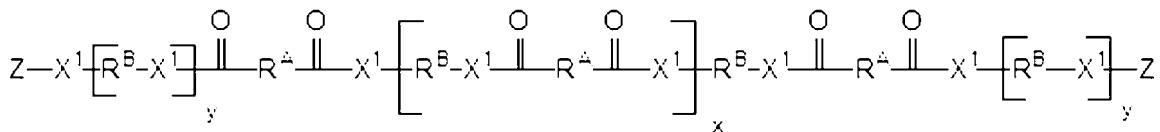
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式：

【化1】



[式中、

R^A は、配向性がない 1 - メチレン - 3 , 3 - ジメチルプロピル基であり、

R^B は、置換されていてもよいヒドロカルビル基であって、少なくとも 2 つの R^B 基は接着した基材の表面に対し結合又はエッティングする官能基 D で置換されており；

X^1 は - O - 又は $N R^5$ - であり、 R^5 は H 又は $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；

Z はエチレン性不飽和重合性基を含み；

y は 0 又は 1 であり；

x は 0 ~ 20 であり、

基材に対し結合又はエッティングする前記 D 基が、モノホスフェート、ホスホネート、ホスホン酸、ホスフィン、ヒドロキサム酸、カルボン酸、アセト酢酸、スルフィン酸、スルホン酸から選択され、

ペンドントの前記 D 単位が

$Y^* - (R^{1\sim 3})_q - X^7 - D$

[式中、

Y^* は、前記 B 単位の求電子性基及び求核性基と、基材の表面に対し結合又はエッティングする基を含む D 化合物との反応により形成される官能基であり、

$R^{1\sim 3}$ は(ヘテロ)ヒドロカルビル基であり、

q は 0 又は 1 であり、

X^7 は共有結合又は二価の連結基から選択され、

D は下にある前記基材に対し結合又はエッティングする官能基である。] により表され得るものである]

の付加 - 開裂オリゴマー。